



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种对InP基RFIC晶圆进行电化学减薄抛光的方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310473279.0
申请日期:	2013-10-11
专利号:	201310473279.0
第一发明人:	汪宁
实施情况:	授权
专利证书号:	201310473279.0
其它备注:	高频高压中心

